(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出顧公開番号

特開平6-41433

(43)公開日 平成6年(1994)2月15日

(51) Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

C08L 83/04 C 0 8 J 3/28 LRV CFH

8319-4J 9268-4F

C08K 5/55

請求項の数9(全 8 頁) 審査請求 有

(21)出願番号

特願平5-86938

(22) 出願日

平成5年(1993)3月23日

(31)優先権主張番号 92-03441

(32)優先日

1992年3月23日

(33)優先権主張国 フランス (FR)

(71)出願人 390023135

ローヌープーラン・シミ

RHONE-POULENC CHIMI

フランス国92408クールプポワ、ケ・ポー

ル・ドウーメ、25

(72)発明者 ジャック・カペザン

フランス国ビルールパンヌ、アレ・マルセ

ル・アシャール、4

(72)発明者 クリスティアン・プリウー

フランス国ビルールパンヌ、リュ・ファイ

ユバン、18

(74)代理人 弁理士 倉内 基弘 (外1名)

(54)【発明の名称】 架橋性官能基を含有するポリオルガノシロキサンを基とする組成物及び抗付着性コーティングの 製造のためのその使用

(57) 【要約】

【目的】 抗付着性コーティングを製造するのに有用 な、カチオン架橋性官能基を含有するポリオルガノシロ キサンを基とする組成物を提供すること。

【構成】 本発明は、カチオン架橋性ポリオルガノシロ キサンと、有効量の「Chemical & Engineering News 」 第63巻、第5号、第26頁(1985年2月4日発 行) に記載の周期分類の第15群~第17群から選択さ れる元素のオニウム硼酸塩とを基とする組成物に関し、 この硼酸塩は、アニオン硼酸塩部分が式 [BX. R.] を有することを特徴とする。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 カチオン架橋性ポリオルガノシロキサン と、有効量の周期分類 {「Chemical & Engineering New s 」第63巻、第5号、第26頁 (1985年2月4日 発行)} の第15群~第17群から選択される元素のオ ニウム硼酸塩とを基とする組成物であって、

前記オニウム硼酸塩のカチオン部分が(1)次式 I $[(R^1), -A-(R^2),]$ (I)(式中、

AはI、S、Se、P、N等のような第15群~第17 10 群から選択される元素を表わし、

R1 はC6 ~C20の複素環式又は炭素環式アリール基を 表わし、該複素環式基は複素原子として窒素、硫黄等を 含有することができ、

R² はR¹ 又はC₁ ~C₃₀の直鎖状若しくは分枝鎖状ア ルケニル若しくはアルキル基を表わし、

これらR1 及びR2 基はC1 ~C28アルコキシ、C1 ~ C25アルキル、ニトロ、クロル、プロム、シアノ、カル ポキシル、メルカプト基等で置換されていてもよく、

nは1~v+1の範囲の整数であり、ここでvは元素A 20 の原子価であり、

mは0~v-1の範囲の整数であり、ここでnとmとの 合計 n + mは v + 1 である) のオニウム塩及び (2) 国 際公開第WO-90/11303号に記載のオキソイソ チオクロマニウム塩、特に2-エチルー4-オキソイソ チオクロマニウム又は2-ドデシル-4-オキソイソチ オクロマニウムスルホニウム塩から選択されること:並 びにアニオン性硼酸塩部分が次式:

[BX, R,] -

{式中、

a及びbは0~4の範囲の整数であり、ここでaとbと の合計a+bは4であり、

記号Xは、

- ・aが0~3である場合にはハロゲン原子(塩素又は弗 素)を表わし、また、
- aが0~2である場合にはOH官能基を表わすことも でき、

記号Rは同一であっても異なっていてもよく、

- ·CFa、NOa、CN等のような少なくとも1個の電 子吸引基で置換されたフェニル基若しくは少なくとも2 40 個のハロゲン原子(特に弗素)で置換されたフェニル基 又は
- ・少なくとも1個の電子吸引基若しくは元素、特にハロ ゲン原子(より特定的には弗素)、CFa、NOa、C N等で債換されていてもよいピフェニル、ナフチル等の ような少なくとも2個の芳香環を含有するアリール基を 表わす〉を有することを特徴とする、前記組成物。

【請求項2】 アニオン性硼酸塩部分が [B (C。F 5)4] - , [B (C₅ H₄ CF₅)₄] - , [(C₅ Fo) 2 BF2] - 、 [CoFoBF3] - 又は [B 50 ようなカチオン架橋性の官能性有機基を表わすかであ

(C₆ H₂ F₂)₄] - であることを特徴とする請求項 1記載の組成物。

【請求項3】 カチオン性オニウム部分が [(Φ)2 $[]^+, [C_1 H_{17} - O - \Phi - I - \Phi]^+, [C_{12} H_{26}]$ $-\Phi - I - \Phi$] + \ [(C₆ H₁₇ - O - Φ) 2 I] + \ $[(\Phi)_{s} S]^{+}, [(\Phi)_{2} - S - \Phi - O - C_{s}$ H_{17}] * 、 $[\Phi - S - \Phi - S - (\Phi)_2]$ * 又は [(C 12 H25 - Φ) 2 [] + であることを特徴とする請求項1 又は2記載の硼酸塩。

【請求項4】 オニウム硼酸塩が [(Φ) 2 I] + [B $(C_6 F_5)_4$]⁻, $[C_{12}H_{26}-\Phi-I-\Phi]^+$ [B $(C_6 F_5)_4$] -, $[(C_6 H_{17}-O-\Phi)_2 I]^+$ [B ($C_{\delta} F_{\delta}$) 4] -, [($C_{\delta} H_{17}$) -O- Φ -I $-\Phi$] * [B (C₅ F₅)₄] -, [(Φ)₃ S] * $[B (C_0 F_0)_4]^-, [(\Phi)_2 - S - \Phi - O - C$ • H17] * [B (C6 H4 CF1)4] * 又は[(C12 $H_{26} - Φ)$ 2 I] + [B (C₆ F₆)₄] - であること を特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の組成物。

【請求項5】 オルガノポリシロキサンがエポキシ、ビ ニルエーテル等のタイプの官能基を有することを特徴と する請求項1~4のいずれかに記載の組成物。

【請求項6】 ポリオルガノシロキサンが・線状若しく は実質的に線状であって次式(II):

化1]

の単位から成り且つ末端が次式(III):

(化2)

の単位であるか、又は・前記式(II)の単位から成る環 状であるか{これら式中、

記号R'は同一であっても異なっていてもよく、置換さ れていてもよいC1~Caの直鎖状若しくは分枝鎖状ア ルキル (例えば3, 3, 3-トリフルオルプロピル) 基、Cs ~Cs シクロアルキル基、アリール(特にフェ ニル)基、置換アリール(例えばジクロルフェニル)基 等であり、ここでR'基の少なくとも60モル%はメチ ル基であり、

記号Yは同一であっても異なっていてもよく、R'基を 表わすか又はエポキシ官能基、ビニルオキシ官能基等の

-256-

り、前記エポキシド、ピニルエーテル等の官能基は2~ 20個の炭素原子を有する二価基を介してシリコーン鎖 の原子に結合し、

記号Yの少なくとも1個はカチオン架橋性の官能性有機 基、好ましくはポリマー1モル当たりに1~20個の官 能性有機基を表わす}のいずれかである請求項5記載の 組成物。

【請求項7】 ポリオルガノシロキサンが25℃におい て約10~1000mm² /sの粘度を示す請求項6 記載の組成物。

【請求項8】 物品をそれが通常付着する表面に対して 非付着性にする方法であって、請求項1~7のいずれか に記載の組成物を該物品のコーティングすべき表面1m ² 当たりに0. 1~5g塗布し、該組成物を光化学的手 段によるか又は電子ビーム下で架橋させることを特徴と する、前記方法。

【請求項9】 架橋操作を約200~400nmの波長 の紫外線照射によって実施する、請求項8記載の方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、カチオン架橋性官能 基を含有するポリオルガノシロキサンを基とする組成 物、抗付着性コーティングを製造するためのその使用及 び固形支持体の少なくとも1つの表面が光化学的活性化 によるか又は電子ピーム下で架橋させた官能性ポリオル ガノシロキサンでコーティングされたことによって抗付 着性にされて成る物品に関する。

[0002]

【従来の技術】官能基(エポキシ、ピニルエーテル等の タイプの官能基)を含有するポリオルガノシロキサンを 30 某とし且つカチオン架橋開始剤としてオニウム塩を添加 された組成物を抗付着性コーティングの製造に使用する ことは公知である(米国特許第4450360号、同第 4576999号及び同第4640967号の各明細 書)。

【0003】オニウム塩のアニオンがSbF。である場 合に最良の結果が得られるということが確認されてい る。しかしながら、このタイプのアニオンを含有する開 始剤には毒性の危険がある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本出願人は、官能基を 含有するポリオルガノシロキサンを基とする新規の組成 物であって、この組成物中に存在させるカチオン開始剤 としてのオニウム塩がSbFe-の求核性に近い求核性を 有するアニオンを含有し且つSbF。 に関する欠点を持 たない前記組成物を見出した。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明の組成物は、カチ オン架橋性ポリオルガノシロキサンと、触媒として有効 量の「Chemical & Engineering News 」第63巻、第5 50 【0008】カチオンとしては、特に次のものを挙げる

号、第26頁(1985年2月4日発行)に従う周期分 類の第15群~第17群から選択される元素のオニウム 硼酸塩とを基とし、この組成物は、(A)オニウム硼酸 塩のカチオン部分が

(1) 次式 I

(I) $[(R^1)_{\bullet} - A - (R^2)_{\bullet}]^{+}$

(式中、AはI、S、Se、P、N等のような第15群 ~第17群から選択される元素を表わし、R1 はC0 ~ C20の複素環式又は炭素環式アリール基を表わし、該複 10 素環式基は複素原子として窒素、硫黄等を含有すること ができ、R² はR¹ 又はC₁ ~C₁₀の直鎖状若しくは分 枝鎖状アルケニル若しくはアルキル基を表わし、これら R¹ 及びR² 基はC1 ~C25アルコキシ、C1 ~C25ア ルキル、ニトロ、クロル、プロム、シアノ、カルポキシ ル、メルカプト基等で置換されていてもよく、nは1~ v+1の範囲の整数であり、ここでvは元素Aの原子価 であり、mは $0 \sim v - 1$ の範囲の整数であり、ここでnとmとの合計n+mはv+1である)のオニウム塩及び (2) 国際公開第WO-90/11303号に記載のオ 20 キソイソチオクロマニウム塩、特に2-エチルー4-オ キソイソチオクロマニウム又は2-ドデシル-4-オキ

ソイソチオクロマニウムスルホニウム塩から選択される こと:並びに(B) オニウム硼酸塩のアニオン性硼酸塩 部分が次式:

[BX, R,]

{式中、a及びbは0~4の範囲の整数であり、ここで aとbとの合計a+bは4であり、記号Xは、

- · aが0~3である場合にはハロゲン原子(塩素又は弗 素)を表わし、また、
- ・aが0~2である場合にはOH官能基を表わすことも でき、記号Rは同一であっても異なっていてもよく、
 - ・CF₃、NO₂、CN等のような少なくとも1個の電 子吸引基で置換されたフェニル基若しくは少なくとも2 個のハロゲン原子 (特に弗素) で置換されたフェニル基 口口
- ・少なくとも1個の元素若しくは電子吸引基、特にハロ ゲン原子(より特定的には弗素)、CF3、NO2、C N等で置換されていてもよいピフェニル、ナフチル等の ような少なくとも2個の芳香環を含有するアリール基を 40 表わす を有することを特徴とする。

【0006】硼酸塩アニオンの例としては、 [B(C) F₅)₄] - , [B (C₆ H₄ CF₅)₄] - , [(C 。F₆):BF:] -、[C₆F₆BF₃] - 及び[B (Co Hs F2) (] を挙げることができる。

【0007】式 【のオニウム塩は多くの文献に記載され ており、特に米国特許第4026705号、同第403 2673号、同第4069056号、同第413610 2号及び同第4173476号の各明細書等に記載され ている。

ことができる: [(Φ) 2 I] ⁺ 、 [C₈ H₁₇ - O - Φ $-I - \Phi$] + , $[C_{12}H_{25} - \Phi - I - \Phi]$ + , $[(C_{6})$ $H_{17} - O - \Phi$) 2 I] + , [(Φ) 3 S] + , [(Φ) $_{2}$ -S- Φ -O-C₈ H₁₇] + , [Φ -S- Φ -S-(Φ) 2] * 及び[(C12H26-Φ) 2 I] * 。

【0009】オニウム硼酸塩の例としては、次のものを 挙げることができる: [(Φ) 2 I] * [B (C₆ F $_{5}$) $_{4}$] $_{-}$, $[C_{12}H_{25}-\Phi-I-\Phi]$ $_{-}$ [B (C₈ F $[(C_8 H_{17} - O - \Phi)_2 I]^+$ [B (C₆ F_5)₄]⁻, [(C₈ H₁₇) -O- Φ -I- Φ]⁺ $[B (C_6 F_5)_4]^-, [(\Phi)_3 S]^+ [B (C_6$ F_5)₄]⁻, [(Φ)₂ -S- Φ -O-C₈ H₁₇]⁺ [B (C₈ H₄ CF₈)₄] - 及び[(C₁₂H₂₅-Φ) 2 I] * [B (C₅ F₅)₄] - .

【0010】本発明の主題を構成するオニウム硼酸塩 は、カチオン部分の塩、特にハロゲン化物(塩化物、沃 化物)とアニオン部分のアルカリ金属塩(ナトリウム、 リチウム又はカリウム塩) との交換反応によって製造す ることができる。操作条件(各反応成分の量、溶媒の選 択、期間、温度、撹拌等) は当業者が知る範囲内であ る。これらは、所望の開始剤塩を、固体状の場合には形 成した沈殿のろ過によって、オイル状の場合には好適な 溶媒を用いた抽出によって回収することを可能にしなけ ればならない。

【0011】アニオン部分のアルカリ金属塩は、既知の 方法で、ハロ硼酸塩化合物と所望の炭化水素基を有する 有機金属化合物(マグネシウム、リチウム、錫等の化合 物)との間の化学量論的量での交換反応及び必要に応じ て続いてのアルカリ金属ハロゲン化物の水溶液を用いた 加水分解によって製造することができる。この種の合成 30 は、例えば「Journal of Organometallic Chemistry) 第178巻、第1~4頁(1979年)、「Journal of the American Chemical Society」第82巻(1960 年)、第5298頁、「Anaiytica Chimica Acta」第4 4巻 (1969年)、第175~183頁、米国特許第 4139681号明細書、ドイツ国特許第290136 7号明細書、「Zhurnai Organicheskoi Khimii」第25 巻、第5号、第1099~1102頁(1989年5 月)に記載されている。

性ポリオルガノシロキサンは、エポキシ、ビニルエーテ ル等のタイプの官能基を有する。このポリオルガノシロ キサンは、

・線状若しくは実質的に線状であって次式(II): 【化3】

$$\begin{array}{c}
R' \\
-(S i - 0) - \\
Y
\end{array}$$
(II)

6

の単位から成り且つ末端が次式(III): [化4]

の単位であるか、又は

・前記式 (II) の単位から成る環状であるか {これら式 中、記号R'は同一であっても異なっていてもよく、置 換されていてもよいC1 ~C。の直鎖状若しくは分枝鎖 状アルキル (例えば3,3,3-トリフルオルプロピ ル)基、C₅ ~ C₈ シクロアルキル基、アリール(特に フェニル) 基、置換アリール (例えばジクロルフェニ ル) 基等であり、ここでR' 基の少なくとも60モル% はメチル基であり、記号Yは同一であっても異なってい てもよく、R' 基を表わすか又はエポキシ官能基、ビニ ルオキシ官能基等のようなカチオン架橋性の官能性有機 基を表わすかであり、前記エポキシド、ビニルエーテル 等の官能基は2~20個の炭素原子を有する二価基を介 してシリコーン鎖の原子に結合し、記号Yの少なくとも 1個はカチオン架橋性の官能性有機基、好ましくはポリ マー1モル当たりに1~20個の官能性有機基を表わ す) のいずれかである。

【0013】エポキシ官能性又はビニルオキシ官能性ポ リオルガノシロキサンは、特にドイツ国特許第4009 889号、ヨーロッパ特許公開第396130号、同第 355381号、同第105341号、フランス国特許 第2110115号、同第2526800号の各明細書 に記載されている。

【0014】エポキシ官能性ポリオルガノシロキサン は、SI-H単位を含有するオイルと4-ビニルシクロ 【0012】本発明の組成物中に含まれるカチオン架橋 40 ヘキセンオキシド、アリルグリシジルエーテル等のよう なエポキシ官能性化合物との間のヒドロシリル化反応に よって製造することができる。ビニルオキシ官能性ポリ オルガノシロキサンは、Si-H単位を含有するオイル とアリルピニルエーテル、アリルピニルオキシエトキシ ベンゼン等のようなビニルオキシ官能性化合物との間の ヒドロシリル化反応によって製造することができる。

> 【0015】エポキシ官能性又はビニルオキシ官能性ポ リオルガノシロキサンは一般的に、25℃において10 ~10000mm²/s、好ましくは100~600m 50 m²/sの粘度を示す流体の形で提供される。

【0016】本発明においてオニウム硼酸塩の触媒とし て有効量とは、架橋を開始させるのに充分な量を意味す る。この量は一般的には、架橋性ポリオルガノシロキサ ン100重量部を光化学的に架構させるためには、0. 01~20重量部の範囲、大抵の場合0.1~8重量部 の範囲である。

【0017】本発明に従う組成物にはさらに、付着性調 節剤(ピニル、エポキシ、ピニルエーテル、アルコール 等の官能基を有する線状シリコーンポリマー又は樹 脂)、顔料、光増感剤、殺菌、殺細菌及び抗微生物剤、 腐蝕防止剤等のような他の成分を含有させることができ る。

【0018】本発明に従う組成物は、そのままで又は有 機溶媒中の溶液状で用いることができる。この組成物 は、セルロース材料、フィルム及びペイントに対する抗 付着性コーティング、電気及び電子部品の封入、織物用 コーティング並びに光学繊維の外装の分野において有用 である。この組成物は、そのままで金属シート、ガラ ス、プラスチック又は紙のような材料を通常それらが付 着する他の材料に対して非付着性にするために用いる場 20 合に特に有利である。この組成物は、25℃において5 000mPa·s以下、好ましくは25℃において40 00mPa·s以下の粘度を有するのが有利である。

【0019】従って、本発明は、物品(例えばシート) をそれが通常付着する表面に対して非付着性にすること ができる方法にも関し、この方法は、所定量、一般的に はコーティングすべき表面 1 m2 当たりに 0. 1~5 g の量の本発明の組成物を塗布し、エネルギー(その少な くとも一部、好ましくは全部は紫外線照射によって提供 される)を供給することによって組成物を架橋させるこ 30 とから成ることを特徴とする。用いられる紫外線は、2 00~400nmの範囲、好ましくは254~360n mの範囲の波長を有する。

【0020】照射期間は短くてもよく、一般的に1秒未 満であり、非常に薄いコーティングについてはほぼ百分 の数秒である。達成される架橋は加熱しない場合にさえ 優れている。もちろん、25~100℃の範囲の加熱は 本発明から除外されない。もちろん、用いる紫外線ラン プの数、紫外線電光時間及び組成物と紫外線ランプとの 距離によって硬化時間を特に調節することができる。

【0021】溶媒を用いない組成物、即ち未希釈組成物 は、少量の液体を均一に塗布することができる装置によ って塗布される。このためには、例えば特に2本の円筒 体を重ねて成る『Helio glissant』と称される装置を用 いることができる。これらの円筒体のうちの下側のもの は組成物が入れられたコーティング槽中に浸漬され、そ の役割は上側の円筒体に非常に薄い層で含浸させること であり、上側の円筒体の役割は所望量の組成物を紙に塗 布して含浸させることである。互いに対して逆方向に回 転する2本の円筒体のそれぞれの速度を調節することに 50 を遮断して減圧(133Pa)下で一晩乾燥させた。テ

よってかかる均一供給が得られる。

【0022】支持体上に塗布する組成物の量は可変的で あり、大抵の場合、処理される表面1m² 当たりに0. 1~5gの範囲である。この量は支持体の種類及び望ま れる抗付着性に依存する。大抵の場合、その量は非孔質 支持体1m2 当たりに0.5~3gの範囲である。

[0023] 本発明の他の主題は、固形材料(金属、ガ ラス、プラスチック、紙等)の少なくとも1つの表面が 前記の組成物でコーティングされ、この組成物が光架橋 され又は電子ピームによって架橋されて成る物品(例え ばシート) にある。

[0024]

【実施例】以下の実施例は本発明を例示するためのもの であり、本発明の範囲及び技術思想を何ら限定するもの ではない。

【0025】例1:テトラキス(ペンタフルオルフェニ ル) 確酸ジフェニルヨードニウム [(Φ) ₂ I] ⁺ [B (Cs Fs) 4] -

【0026】テトラキス(ペンタフルオルフェニル)硼 酸リチウムの製造:機械式撹拌機、水冷式還流冷却管、 **温度計及び滴下漏斗を備えた4000ミリリットルの四** つ口丸底フラスコを用いた。装置は前もってアルゴン秀 囲気下で乾燥させた。無水ペンタン1600ミリリット ル及びプロムペンタフルオルベンゼン126.8g (0.513モル)を装入した。この全体を撹拌し、次 いで固形二酸化炭素/アセトン浴を用いて−75℃に冷 却した。ヘキサン中1.6M濃度のn-ブチルリチウム 溶液313ミリリットルを滴下漏斗に装入し、次いで5 0分かけて滴下した。次いでこの混合物を-78℃の温 度において5時間撹拌した。ヘキサン中1M濃度の三塩 化研素溶液125ミリリットルを滴下漏斗に装入し、3 0分かけて混合物に添加した。冷却浴を取り除き、反応 混合物を放置して室温に戻した。次いでこれを12時間 撹拌した。水625ミリリットルをゆっくり添加するこ とによって反応混合物を加水分解した。2相に分離し、 有機相を125ミリリットルずつの水で2回洗浄した。 水相を一緒にし、次いで125ミリリットルずつのエー テルで3回抽出した。エーテル相を一緒にし、硫酸マグ ネシウムによって乾燥させた。減圧下でエーテルを蒸発 40 させて、テトラキス(ペンタフルオルフェニル)硼酸リ チウム101gが回収された。収率99%。

【0027】テトラキス(ペンタフルオルフェニル)確 酸ジフェニルヨードニウムの製造:1000ミリリット ルの三角フラスコ中で塩化ジフェニルヨードニウム7. 17g(22.6ミリモル)を水300ミリリットル中 に溶解させた。水250ミリリットル中にテトラキス (ペンタフルオルフェニル) 確酸リチウム15.52g (22.6ミリモル)を含有させた溶液を滴下した。こ の混合物を30分間撹拌し、次いでろ過した。ろ液を光

トラキス(ペンタフルオルフェニル)硼酸ジフェニルヨ ードニウム16.33gが回収された。収率75%。

【0028】例2:テトラキス(ペンタフルオルフェニ ル) 硼酸(4-オクチルオキシフェニル)フェニルヨー ドニウム [(C₈ H₁₇) $-O-\Phi-I-\Phi$] * [B (C 6 F₅)₄]⁻

【0029】オクチルフェニルエーテルの製造:機械式 撹拌機、温度計及び水冷式還流冷却管を備えた500ミ リリットルの三つ口丸底フラスコに、フェノール44. 8g (0.477モル)、n-プロムオクタン38.6 10 g(0.2モル)、臭化テトラプチルアンモニウム6 g、水酸化カリウム26.8g、水100ミリリットル 及びトルエン100ミリリットルを装入した。この全体 を撹拌し、次いで20時間還流した。次いで反応混合物 を室温まで冷却した。静置して、相を分離した。有機相 を0.5N水酸化ナトリウム溶液100ミリリットルで 洗浄し、次いで100ミリリットルずつの水で5回洗浄 した。次いで硫酸マグネシウムによって乾燥させ、次い で溶媒を減圧下で85℃の温度において除去した。n-オクチルフェニルエーテル41.5g(収率95%)が20 回収され、これはさらに精製することなく続いて用いる ことができた。

【0030】ヒドロキシトシルオキショードベンゼンの 製造:機械式撹拌機、水冷式還流冷却管及び滴下漏斗を 備えた1000ミリリットルの丸底フラスコに、ヨード ベンゼンジアセテート80.53g(0.25モル)、 水300ミリリットル及び酢酸100ミリリットルを装 入した。この全体を撹拌し、40℃に加熱した。次いで p-トルエンスルホン酸-水和物47、55g(0.2) 5モル)を滴下漏斗によって5分かけて添加した。反応 30 混合物を40℃に2時間保ち、次いで25℃に冷却し た。白色沈殿が形成した。これをろ過によって回収し、 次いで減圧下で乾燥させた。所望の物質68、15gが 得られた。収率70%。

【0031】(4-オクチルオキシフェニル)フェニル ヨードニウムトシレートの製造:電磁式撹拌棒を備えた 250ミリリットルの三角フラスコに、ヒドロキシトシ ルオキシヨードベンゼン22.2g(0.057モ ル)、n-オクチルフェニルエーテル9g(0.04モ ル)、アセトニトリル5ミリリットル及び酢酸1.5ミ 40 リリットルを装入した。この混合物を撹拌し、40℃の 温度に2時間30分間加熱した。次いで氷酢酸1.5ミ リリットルを添加し、次いでこの混合物を40℃におい て5時間放置した。反応混合物を放置して冷却し、激し く撹拌しながら水150ミリリットルを添加した。次い でこの混合物を室温において12時間撹拌し、次いで相 分離した。有機相を黄色の沈殿が形成するまで水で数回 洗浄した。この固形分をろ過によって回収し、エーテル 50ミリリットルで洗浄し、次いで真空下で45℃の温

10 ル) フェニルヨードニウムトシレート19.5gが回収 された。収率76%。

【0032】テトラキス(ペンタフルオルフェニル)硼 酸(4-オクチルオキシフェニル)フェニルヨードニウ ムの製造:電磁式撹拌棒を備えた500ミリリットルの 三角フラスコ中で(4-オクチルオキシフェニル)フェ ニルヨードニウムトシレート5g(0.0086モル) をアセトン350ミリリットル中に溶解させた。光を遮 断しながら、アセトン50ミリリットル中にテトラキス (ペンタフルオルフェニル)硼酸リチウム3.4g (0.0103モル)を含有させた溶液を添加した。こ の混合物を48時間撹拌し、次いで生成したp-トルエ ンスルホン酸リチウムを除去するためにろ過した。減圧 下でアセトンを蒸発させて、テトラキス(ペンタフルオ ルフェニル) 硼酸 (4-オクチルオキシフェニル) フェ ニルヨードニウム7.98gが回収された。収率92 %.

【0033】例3:テトラキス(ベンタフルオルフェニ ル) 硼酸ピス (ドデシルフェニル) ヨードニウム [(C $_{12}H_{25}-\Phi)_{2}I]^{+}[B(C_{6}F_{5})_{4}]^{-}$

【0034】塩化ビス (ドデシルフェニル) ヨードニウ ムの製造:機械式撹拌機、水冷式還流冷却管及び滴下漏 斗を備えた1000ミリリットルの丸底フラスコに、ド デシルペンゼン100g(0.405モル)、沃素酸力 リウム43.5g(0.203モル)、酢酸199.6 g及び無水酢酸59.5gを装入した。この混合物を撹 拌し、次いで氷浴中で0℃に冷却した。硫酸59.8g と酢酸39.86gとの混合物を滴下漏斗に装入した。 この混合物を25分かけて反応混合物に添加した。この 反応混合物を室温において18時間撹拌した。次いで水 750ミリリットルを添加し、次いで反応混合物を35 0ミリリットルずつのエーテルで3回抽出した。エーテ ル相を一緒にし、次いで減圧下で蒸発させた。濃縮物を 飽和塩化ナトリウム溶液540ミリリットル中に取り出 し、次いでこの混合物を氷浴中で2時間冷却した。生成 物を第4番ガラス漏斗を用いたろ過によって回収した。 次いで固形物をアセトンから2回再結晶した。ろ過によ って、塩化ビス (ドデシルフェニル) ヨードニウム 6 9. 18gが回収された。収率52%。

【0035】テトラキス(ベンタフルオルフェニル)硼 酸ピス(ドデシルフェニル)ヨードニウムの製造 1000ミリリットルの三角フラスコ中で塩化ビス(ド デシルフェニル) ヨードニウム3.76gをアセトン5 00ミリリットル中に溶解させた。次いで、アセトン1 00ミリリットル中にテトラキス (ペンタフルオルフェ ニル) 硼酸リチウム5gを含有させた溶液を滴下した。 この混合物を光を遮断して2日間撹拌し、次いで生成し た塩化リチウムをろ過によって除去した。アセトンを蒸 発させた後に、テトラキス(ペンタフルオルフェニル) 度において乾燥させた。(4-オクチルオキシフェニ 50 硼酸ピス (ドデシルフェニル) ヨードニウム8gが回収 された。収率90%。

【0036】例4~10:次の一般的手順に従った。トリメチルシリル末端基及びエポキシ官能基を含有するオルガノポリシロキサンから成るポリマーA100重量部に、溶媒(メタノール又は2-エチルへキサンジオール)中の2重量%溶液としての光開始剤0.5重量部を添加した。手動で30分間撹拌した後に、混合物を厚さ45 μ mのテレファン(Terephane)(登録商標名)6868フィルム(ローヌープーラン社より販売)に強布した(ほぼ0.5~3g/m²)。

【0037】コーティングされたフィルムをフュージョン・システム(Fusion System) (登録商標名) F45 0タイプの紫外線ランプ {フュージョン(Fusion) 社より販売} (波長360nm、電極不在、マイクロ波による励起、電力120W/cm照射を特徴とする)の下に通過させた。32m/分の速度でランプの下を1回通過させた場合の照射エネルギー {エイトーUSA(Eit-USA)社から入手したユヴィキュア(Uvicure)(登録商標名)セルを用いて測定}は、0.025J/cm²だった。シリコーン層を硬化させるのに必要な走行速度20(m/分)を記録した。

【0038】硬化後に得られたコーティングの品質を、 シリコーン層を

- ・FINAT第3番試験に従ってゴム系接着剤(Tesa4154及びTesa4651)と20℃において20時間接触させた後の抗付着性、及び
- ・FINAT第10番試験に従ってアクリル系接着剤 (Tesa4970)と70℃において20時間接触さ

12

せた後の抗付着性を測定することによって評価した。

【0039】他方、直後の付着性(SA)はシリコーン層の重合の程度を表わす。FINAT第11番試験に従って測定を実施した。各例において次のものを用いて得られた結果を第1表に示す。

【0040】例4及び5 (比較例):

- ・100g当たりに104ミリ当量のエボキシド官能基を含有し且つ25℃において600mm²/sの粘度を有する式MD¹4D40M(ここで、Mは(CH2)sSi

 10 O1/2 であり、D¹ は(4-シクロヘキセンオキシド)
 (CH3) SiO2/2 であり、Dは(CH3)2 SiO
 2/2 である)のポリオルガノシロキサンA1及び
 - ・2-エチルヘキサンジオール中の溶液状のヘキサフルオロアンチモン酸ピス(ドデシルフェニル)ヨードニウムから成る光開始剤B1

[0041]例6~8:

- ・ポリオルガノシロキサンA1及び
- ・メタノール中の溶液状のテトラキス(ベンタフルオルフェニル)硼酸ジフェニルヨードニウムから成る光開始 剤B₂

[0042]例9及び10:

- ・100g当たりに128ミリ当量のエポキシド官能基を含有し且つ25℃において500mm²/sの粘度を有する式MD²4D20M(ここで、M、D²及びDは上記の定義を有する)のポリオルガノシロキサンA2及び
- ·光開始剤B:

[0043]

【表1】

14

第1表

T-ii	速度	塗布量	抗付着性(g/cm)			SA
例	(m/ /))	(g/m²)	Tesa 4154 20℃、20時間	Tesa 4651 20°C、20時間	Tesa 4970 70℃、20時間	(%)
4	100	1. 0	1. 4	6. 0	65	78
5	130	1. 2	1. 5	6. 9	43	75
6	100	1. 1	1. 6	9. 2	17	86
7	130	0. 9	1.8	10	2 2	80
8	150	0.7	1. 7	9. 7	37	95
9	100	1. 2	30	56	55	86
10	190	1. 0	16	45	76	96